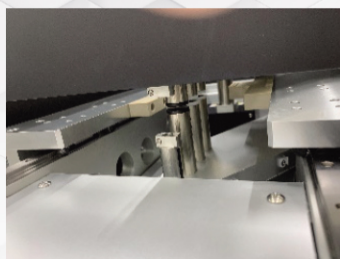


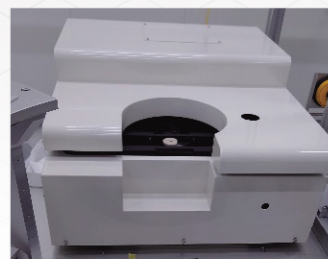
非接触式(渦電流法)シート抵抗 / 抵抗率測定システム

Non-contact sheet resistance / resistivity measurement system

NC-2000FLA



抵抗率プローブ
Resistivity probe



平坦度測定ユニット
Flatness measurement unit

機能・特長

Specifications

抵抗率/平坦度(厚さ)/PN判定を全て非接触測定

Non-contact measurement of resistivity, Flatness (thickness) and conductivity (P/N)

抵抗率は渦電流法、平坦度は静電容量法を採用

Eddy current method for resistivity, Electric capacitance method for flatness (thickness)

測定後、設定した規格値に合わせてソーティングが可能

Sorting as the set standard value

カセット数はご要望によりいくつでも対応可能

Number of cassette station can be changed by customer's request

温度計、温度補正機能付き(シリコンウェハ用)

Temperature correction for silicon wafer function

測定対象

Applications

半導体料関連(シリコン、ポリシリコン、SiCなど)

Semiconductor materials, (Silicon, Polysilicon, SiC etc)

化合物系ウェハ、化合物上エピ (GaAs Epi, GaN Epi, InP, Ga等)

Chemical compound semiconductor (GaAs Epi, GaN Epi, InP, Ga etc)

測定レンジ

Measurement range

抵抗率測定レンジ Resistivity measurement range

0.00075~225 Ω・cm

*厚さ750umの場合 Thickness : 750um

| 測定項目 Measurement item | 平坦度測定レンジ Flatness measurement range |
|--|---|
| Thickness Warp<100umの場合 In case of Warp<100um | 225~1,225 μm SEMI スタンダードウェハに準拠 Compatible with SEMI standard wafer |
| BOW | +/- 350 μm |
| WARP | 350 μm |

